

公益社団法人 応用物理学会

薄膜・表面物理分科会／シリコンテクノロジー分科会 共催

第30回 電子デバイス界面テクノロジー研究会 —材料・プロセス・デバイス特性の物理—

■ 2025年1月23日(木)～1月24日(金)

*1月22日(水)夜にチュートリアル講演開催

■ 静岡県総合コンベンション施設プラサヴェルデ
(静岡県沼津市)

■ 研究会ウェブサイト <http://edit-ws.jp/>

電子デバイスの性能向上・集積化・機能発現に向けて、その鍵を握る界面の基礎から応用までの幅広いテーマについて、実験と理論の両面から深く議論する研究会です。応用物理学会 薄膜・表面物理分科会およびシリコンテクノロジー分科会共催の特別研究会として、1996年から2004年までは「極薄シリコン酸化膜の形成・評価・信頼性研究会」、2005年から2015年までは「ゲートスタック研究会 —材料・プロセス・評価の物理—」との名称で開催され、2016年から現在の「電子デバイス界面テクノロジー研究会 —材料・プロセス・デバイス特性の物理—」となりました。

一般講演募集

(口頭またはポスター発表)

講演申し込み: **2024年10月31日(木) 締切**

予稿原稿投稿: **2024年12月27日(金) 締切**

* 詳細は研究会ウェブサイト「講演申込」をご参照ください

本研究会は参加者による“議論”を目的としていますので、予稿集は出版物ではなく参加者限りの資料となります。予稿集の引用や2次利用は想定していません。

